

# I. 試料の形成・加工・処理のための装置

## 1-1. 機械加工・研磨・4D成形など

装置名	研究室名
NC旋盤	工作実習工場
普通旋盤	工作実習工場
高速精密旋盤	工作実習工場
NCフライス盤	工作実習工場
立型フライス盤	工作実習工場
ラジアルボール盤	工作実習工場
形彫放電加工機	工作実習工場
ワイヤーカット放電加工機	工作実習工場
3次元測定器	固体力学
超微細レーザ加工装置	光機能物質

装置名	研究室名
放電プラズマ焼結機	材料プロセス
クロスセクションポリッシャ	情報記録工学
集束イオンビーム加工機	半導体
集束イオンビーム加工観察装置	情報記録工学
平面研削盤	工作実習工場
円筒研削盤	工作実習工場
精密カッティングマシン	工作実習工場
射出成形機	工作実習工場
溶接機	工作実習工場

## 1-2. マイクロ・ナノ構造形成用プロセス

装置名	研究室名
分子線エピタキシー装置	電子デバイス
多成分クラスターイオン生成装置	クラスター
イオン銃	クラスター
ナノ構造半導体形成装置	電子デバイス
薄膜試料用マグネトロンスパッタ装置	フロンティア材料
スパッタ装置・RF仕様	界面制御プロセス
高真空薄膜作成装置	界面制御プロセス
真空蒸着装置	半導体
特殊改良型イオンビームスパッタ装置	情報記録工学
バッチ式スパッタリング装置	半導体

装置名	研究室名
分子線エピタキシー(MBE)装置	半導体
反射防止膜成膜実験装置	半導体
複合CVD装置	マイクロエレクトロニクス
常圧CVD装置	半導体
ケミカルビームエピタキシー(CBE)装置	半導体
光機能導波路素子作製装置	光機能物質
スクリーン印刷機	半導体
電極印刷機	半導体
有機半導体薄膜作製装置	量子界面物性
量子界面構造作製装置	量子界面物性

## 1-3. 化学合成・加熱処理・真空処理など

装置名	研究室名
小型オートクレーブ	界面制御プロセス
真空定温乾燥器	界面制御プロセス
小型ターボ分子ポンプ排気装置	界面制御プロセス
超高真空摩擦試験機	機械創成
クラスター温度制御装置	クラスター
拡散炉(1)	半導体
拡散炉(2)	半導体
シリコンウェハー熱処理装置	電子デバイス
雰囲気可変高温電気炉	フロンティア材料
温度勾配器	フロンティア材料

装置名	研究室名
雰囲気可変型加熱装置	半導体
高速熱処理装置	半導体
加熱装置	半導体
シリコン結晶成長炉	半導体
単結晶育成装置	光機能物質
光散乱測定用高温炉	フロンティア材料
FCVD装置加熱炉	フロンティア材料
先端フォトニクス材料製造装置	フロンティア材料
真空活性ガス雰囲気熱処理炉	材料プロセス
ターボ分子ポンプ	クラスター

## 1-4. その他

装置名	研究室名
超臨界CO <sub>2</sub> 含浸装置	高分子ナノ複合材料
洗浄ドラフト(無機ドラフトPre-Clean)	半導体
洗浄ドラフト(SDE+TEX)	半導体
洗浄ドラフト(角洗浄槽付)	半導体

装置名	研究室名
レーザ加工機	工作実習工場
プリント基板加工機	工作実習工場
3次元プリンタ(積層造形)	工作実習工場
3次元プロッタ(切削造形)	工作実習工場